

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成22年11月4日 (2010.11.4)

【公開番号】特開2009-155726(P2009-155726A)

【公開日】平成21年7月16日 (2009.7.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-028

【出願番号】特願2008-292174(P2008-292174)

【国際特許分類】

C 2 5 D 21/10 (2006.01)

C 2 5 D 21/00 (2006.01)

C 2 5 D 7/12 (2006.01)

C 2 5 D 5/08 (2006.01)

C 2 5 D 17/10 (2006.01)

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【 F I 】

C 2 5 D 21/10 3 0 1

C 2 5 D 21/00 E

C 2 5 D 7/12

C 2 5 D 5/08

C 2 5 D 17/10 A

H 0 1 L 21/92 6 0 4 B

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月14日 (2010.9.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 9 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 9 4 】

このように、調整板移動機構 1 4 2 を介して、調整板 1 3 4 の基板 W に対する水平方向の位置を微調整したり、調整板移動機構 1 6 0 を介して、調整板 1 3 4 の基板 W に対する水平及び垂直方向の位置を微調整したりすることで、基板 W の表面に形成されるめっき膜の膜厚の面内均一性を向上させることができる。特に、調整板 1 3 4 は、基板 W に近接した位置に配置されるため、調整板 1 3 4 の基板 W に対する垂直または水平方向の位置を微調整することが、基板 W の表面に形成されるめっき膜の膜厚の面内均一性を向上させる上で重要となる。